

Изменение длительности фронта воздействующего напряжения ($\tau_\phi = 15$ мкс) на качественной картине поведения поля не сказывается. Отметим лишь, что время формирования пробоя существенно уменьшилось из-за увеличения скорости распространения лидера и увеличения длины стримерной зоны в финальной стадии (см. рисунок, г).

Таким образом, полученные результаты показывают, что изменение во время напряженности электрического поля искрового разряда определяющее влияние оказывает пространственный заряд стримерной зоны и канала лидера. Характерной особенностью поведения электрического поля в чехле канала лидера при пробое является изменение его полярности. Время нейтрализации пространственного заряда растет с увеличением длины промежутка или радиуса чехла канала лидера. Максимальное значение электрического поля достигается в стримерной зоне лидера и составляет 4–6 кВ/см.

В заключение авторы выражают благодарность В.Р. Аванскому, Г.И. Алексюткину и В.М. Кудрякову за помощь в проведении экспериментов.

Список литературы

- [1] Базелян Э.М. // ЖТФ. 1964. Т. 34. № 36. С. 474–483.
- [2] Waters R.T. // J. Phys. E. 1972. V. 5. P. 475–478.
- [3] Hidaka K., Murooka Y. // IEEE Proc. 1985. V. 132. Pt. A. N 3. P. 139–146.
- [4] Горчаков В.К., Кузнецова В.В., Потапов В.Т. // Радиотехника. 1988. № 8. С. 28–31.
- [5] Чернов Е.Н. Генератор импульсных напряжений 9–МВ наружной установки. Материалы Всес. н.–т. конф. „Ленинский план электрификации СССР в действии”. М., 1981. С. 15.

Всесоюзный электротехнический
институт им. В.И. Ленина

Поступило в Редакцию
15 августа 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 23

12 декабря 1989 г.

04

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ В ВОДЕ

Н.И. Кускова

Ранее было показано, что развитие наносекундного разряда в воде связано с термополевой диссоциацией (эффектом Френкеля) при максимальных напряженностях поля $E \approx 10^9$ В/м [1, 2].

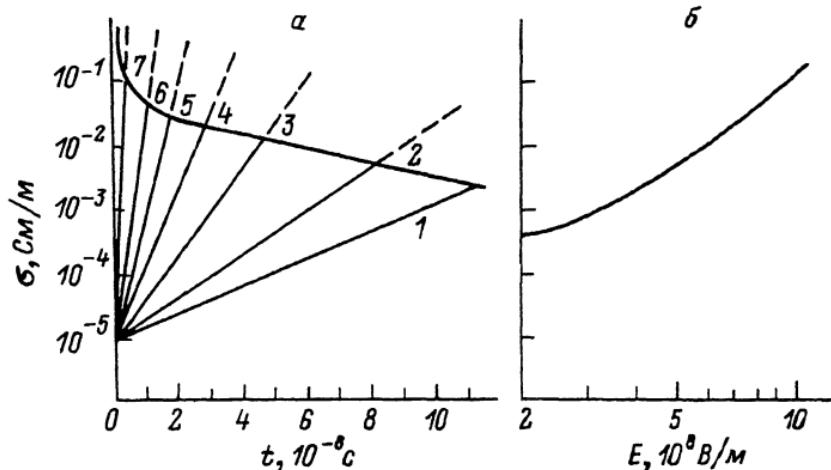


Рис. 1. а) Зависимость максимальной электропроводности от максимальной напряженности поля. б) Зависимость электропроводности от времени при различных значениях максимальной напряженности поля: 1 - $E = 5 \cdot 10^8$, 2 - $6 \cdot 10^8$, 3 - $7 \cdot 10^8$, 4 - $8 \cdot 10^8$, 5 - $9 \cdot 10^8$, 6 - 10^9 , 7 - $1.1 \cdot 10^9$ В/м.

Проведенные экспериментальные исследования начальных стадий формирования электрического пробоя в воде электропроводностью $\sigma \approx 10^{-5}$ См/м в однородном поле при средних напряженностях $E = (3.3 \dots 4.3) \cdot 10^7$ В/м позволили авторам работы [3] сделать вывод об определяющей роли термополевой диссоциации, приводящей к иницииации пробоя в области усиления поля (вблизи микроострий на поверхности анода) в микросекундном диапазоне, перераспределению поля в промежутке и формированию первичного плазменного канала, в котором реализуются условия для дальнейшего развития пробоя.

Таким образом, термополевая диссоциация может являться первой стадией формирования электрического пробоя в воде не только в нано-, но и в микросекундном диапазоне, если напряженность поля в приэлектродной области достаточно велика.

Определим интервалы напряженности поля, в которых реализуются разряды в нано- или микросекундном диапазоне, и возможные механизмы их развития. Для анализа механизмов формирования пробоя воспользуемся приближенными зависимостями основных параметров первичных плазменных каналов, образующихся при термополевой диссоциации, от максимальной напряженности поля.

В работе [2] получено выражение для максимальной степени диссоциации $\alpha = \rho/N$ (ρ - концентрация протонов H^+ , N - концентрация молекул воды) в формирующемся плазменном канале

$$\alpha_{max} \approx \left(\frac{E K(E_{max})}{2 e \mu N} \right)^{1/2}, \quad (1)$$

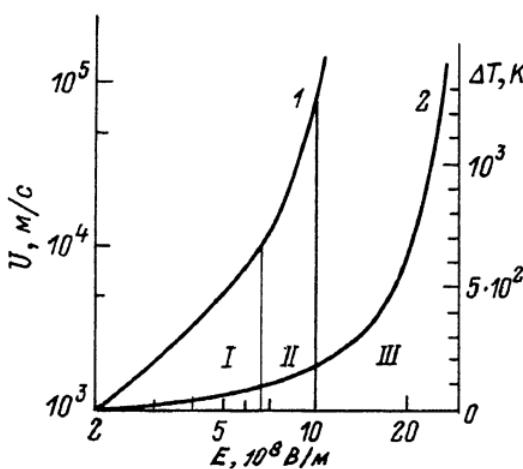


Рис. 2. Зависимости скорости распространения (1) и температуры (2) первичного плазменного канала от максимальной напряженности поля.

где E_{max} – максимальная напряженность поля, ϵ – диэлектрическая проницаемость, $K(E)$ – зависимость коэффициента скорости диссоциации от напряженности поля, μ – подвижность протонов.

Тогда максимальная электропроводность в канале определяется выражением

$$\sigma_{max} \approx [2e\epsilon\mu K(E_{max}) \cdot N]^{1/2}. \quad (2)$$

При достаточно больших значениях E_{max} возрастание электропроводности пропорционально времени $\sigma \approx 2e\mu K(E) \cdot Nt$. Построим зависимости $\sigma(t)$ при различных значениях напряженности поля. Так как рост электропроводности ограничен максвелловским временем релаксации τ_M , то можно построить также кривую, ограничивающую рост электропроводности во времени, согласно выражению (2).

На рис. 1 представлены зависимости электропроводности от максимальной напряженности и от времени.

Построим график зависимости скорости распространения первичного канала U от напряженности поля по выражению, полученному в работе [1],

$$U \approx K(E_{max}) \cdot d_{max}^{-1} \cdot r + \mu E_{max}, \quad (3)$$

где r – радиус канала, d_{max} определяется выражением (1).

Из графика, представленного на рис. 2, следует, что при напряженностях поля $E > 10^9$ В/м скорость распространения канала $U \approx 10^5$ м/с, а при $6 \cdot 10^8 \leq E \leq 10^9$ В/м скорость $U \approx 10^4 - 5 \cdot 10^4$ м/с.

Для оценки максимального изменения температуры в первичном канале ΔT можно воспользоваться приближенным выражением

$$\Delta T = T_{max} - T_0 \approx \frac{\epsilon_{max} \cdot E_{max}^2}{\rho c} \cdot \tau_m, \quad (4)$$

где ϵ_{max} определяется выражением (2), ρ – плотность, c – теплопроводность.

На рис. 2 представлена расчетная зависимость максимального изменения температуры в первичном канале от напряженности поля, которая позволяет определить интервалы напряженности поля, в которых могут реализоваться различные механизмы формирования пробоя.

Так, область I ($\Delta T < 80$ К), которой соответствуют напряженности поля $E < 6.6 \cdot 10^8$ В/м, является областью, в которой образуется слабоионизованный плазменный канал (степень диссоциации $\alpha < 2 \cdot 10^{-6}$). Формирование такого канала не может вызвать изменений среды, с которыми будет связано дальнейшее развитие пробоя (ионизация, фазовый переход). Таким образом, при $E_{max} < 6.6 \cdot 10^8$ В/м термополевая диссоциация не приводит к инициации пробоя. В этой области, по-видимому, инициация пробоя осуществляется газовым разрядом в микропузьрях, содержащихся в воде.

В области II ($6.6 \cdot 10^8 \leq E \leq 10^9$ В/м) температура в первичном канале оказывается достаточной для вскипания воды (при нормальных условиях). Здесь вскипание микрообъемов воды, происходящее со скоростью порядка скорости звука в воде, является возможной стадией дальнейшего развития разряда. Изменение начальной температуры или внешнего давления приведет к смещению границы между областями I и II, т.к. температура кипения и другие физические характеристики зависят от внешнего давления.

В области III ($E > 10^9$ В/м) скорость роста температуры максимальна, при этом возрастет скорость термической диссоциации, что приведет к возрастанию электропроводности и повышению температуры в канале до величин $\sim 10^3$ К. Термические диссоциация и ионизация, а также тепловой пинч являются факторами, приводящими к преобразованию первичного канала в лидер и дальнейшему росту температуры до величин $\sim 10^4$ К.

Таким образом, в области напряженностей $E = (6.6-20) \cdot 10^8$ В/м термополевая диссоциация воды в прианодной области инициирует формирование пробоя, приводя к перераспределению поля и распространению первичного плазменного канала, в котором реализуются условия для дальнейшего развития предпробивных процессов. Механизмы начальной стадии формирования пробоя в микро- и наносекундном диапазонах при указанных напряженностях поля одинаковы, различны скорости протекания предпробивных стадий и значения основных параметров, которые могут отличаться на 1...2 порядка.

При напряженностях поля $6.6 \cdot 10^8 \leq E \leq 10^9$ В/м первичные каналы образуются за времена $t \sim 10^{-8}$ с, их скорость $\sim 10^4$ м/с, температура превышает температуру кипения воды, при этом формирование пробоя происходит в микросекундном диапазоне.

При $E > 10^9$ В/м формирование пробоя происходит за времена $t < 10^{-8}$ с (наносекундный разряд), скорость распространения плазменных каналов $\sim 10^5$ м/с, температура достигает значений $\sim 10^3$ К.

Приведенные результаты согласуются с известными экспериментальными данными.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Кускова Н.И. // ЖТФ. 1983. Т. 53. В. 5. С. 924-925.
- [2] Косенков В.М., Кускова Н.И. // ЖТФ. 1987. Т. 57. В. 10. С. 2017-2020.
- [3] Авроров А.П., Воробьев В.В. Препринт ИЯФ СО АН СССР № 83-69. Новосибирск. 1983.

Поступило в Редакцию
8 августа 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 23

12 декабря 1989 г.

07

ФОТОСТИМУЛИРОВАННЫЙ СДВИГ ПОЛОСЫ СЕЛЕКТИВНОГО ОТРАЖЕНИЯ В ИНДУЦИРОВАННОМ ХОЛЕСТЕРИЧЕСКОМ ЖИДКОМ КРИСТАЛЛЕ

В.Б. Виноградов, Л.А. Кутуля,
Ю.А. Резников, В.Ю. Решетняк,
А.И. Хижняк

Одним из типов оптической нелинейности жидкокристаллов является конформационная нелинейность, обусловленная изменением формы молекул при поглощении света [1]. В нематиках конформационная нелинейность проявляется в зависимости показателя преломления n от интенсивности света I , обусловленной изменением поляризуемости χ молекул при фотопревращении и параметре порядка s нематика вблизи них [2-3].

В холестерических жидкокристаллах (ХЖК) изменение формы молекул может приводить, кроме изменения χ и s , к изменению их закручивающей способности β , т.е. к светоиндуцированному изменению шага холестерической спирали ρ и, как следствие, к сдвигу максимума полосы селективного отражения ХЖК λ_m [4]. В чистом виде такая нелинейность должна проявляться в индуцированных ХЖК на основе нематических матриц с закручивающими добавками. Этим системам присущее сохранение параметров холестерической спирали